(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年12月5日(05.12.2024)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2024/248021 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2024/019656

(22) 国際出願日： 2024年5月29日(29.05.2024)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2023-090176 2023年5月31日(31.05.2023) JP

(71) 出願人: セントラル硝子株式会社 (**CENTRAL GLASS COMPANY, LIMITED**) [JP/JP]; 〒7550001 山口県宇部市大字沖宇部５２５３番地 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者: 鉄村 美月 (**TETSUMURA Mizuki**); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町３丁目７番地１ セントラル硝子株式会社内 Tokyo (JP). 武久 彩香(**TAKEHISA Ayaka**); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町３丁目７番地１ セントラル硝子株式会社内 Tokyo (JP). 公文 創一(**KUMON Soichi**); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町３丁目７番地１ セントラル硝子株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水 進治(**HAYAMI Shinji**); 〒1410031 東京都品川区西五反田７丁目９番２号 ＫＤＸ五反田ビル９階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

WO 2024/248021 A1

(54) **Title:** FILM-FORMING COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCING SUBSTRATE, AND METHOD FOR PRODUCING FILM-FORMING COMPOSITION

(54) 発明の名称： 膜形成用組成物、基板の製造方法、および膜形成用組成物の製造方法

(57) **Abstract:** A film-forming composition according to the present disclosure is used for forming a water-repellent film and comprises (I) a silylation agent, (II) a chlorine-containing silyl ester compound, and (III) an aprotic solvent.

(57) 要約：本開示の膜形成用組成物は、撥水性膜を形成するために用いる膜形成用組成物であって、（Ｉ）シリル化剤と、（ＩＩ）塩素含有シリルエステル化合物と、（ＩＩＩ）非プロトン性溶媒と、を含む。